

令和元年 12 月 吉日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 柿本 浩一

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 167 回研究会 開催通知

日時：2020 年 1 月 31 日（金）13:00 ～ 17:30

会場：明治大学 駿河台キャンパス 大学会館 第 1、2 会議室

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL 03-3296-4545) JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線／御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分 東京メトロ千代田線／新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分 都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線／神保町駅 下車徒歩 5 分

テーマ 「Si フォトニクスにおける材料・プロセス・デバイス技術の最前線」

世話人：石川靖彦(豊橋技術科学大学)、志村考功(大阪大学)

10:30～12:10 幹事会

12:10～13:00 委員総会 (委員および産業界の代理出席者・同行者は昼食が出ます)

プログラム

13:00～13:05 開会の挨拶 九州大学 柿本浩一

13:05～13:10 はじめに 豊橋技術科学大学 石川靖彦

13:10～13:50 「シリコンフォトニクス技術の現状とその進化形」
産業技術総合研究所 山田浩治

13:50～14:30 「エピタキシャル成長に基づく III-V/Si 光集積回路プラットフォーム技術」
NTT 先端集積デバイス研究所 松尾慎治

14:30～15:10 「LSI 間の大容量伝送を実現するシリコンフォトニクスデバイス」
(株) 富士通、技術研究組合光電子融合基盤技術研究所 田中 有

15:10～15:25 休憩

15:25～16:05 「大口径 SOI を用いた光集積デバイスの製造・評価技術」
光電子融合基盤技術研究所、産業技術総合研究所 堀川 剛

16:05～16:45 「GeSn 混晶半導体の核形成制御液相結晶化と光電子融合デバイス応用」
大阪大学 渡部平司

16:45～17:25 「金属/Ge 界面のショットキー障壁制御と光デバイス応用」
九州大学 中島 寛

17:25～17:30 おわりに 大阪大学 志村考功

17:40～19:40 意見交換会(明治大学駿河台キャンパス リバティティータワー 2 3F サロン燦)
以上